「次世代大型有機 EL ディスプレイ基盤技術の開発 (グリーン IT プロジェクト)」 事後評価報告書(案)概要

目 次

分科会委員名簿	1
プロジェクト概要	2
評価概要(案)	6
評点結果	4
(参考)評価項目・評価基準1	8

はじめに

本書は、第35回研究評価委員会において設置された「次世代大型有機 EL ディスプレイ基盤技術の開発(グリーン IT プロジェクト)」(事後評価)の研究評価委員会分科会(第1回(平成25年11月8日))において策定した評価報告書(案)の概要であり、NEDO技術委員・技術委員会等規程第32条の規定に基づき、第38回研究評価委員会(平成26年3月27日)にて、その評価結果について報告するものである。

平成26年3月

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構研究評価委員会「次世代大型有機ELディスプレイ基盤技術の開発 (グリーンITプロジェクト)」分科会 (事後評価)

分科会長 半那 純一

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 「次世代大型有機 EL ディスプレイ基盤技術の開発

(グリーン IT プロジェクト)」(事後評価)

分科会委員名簿

(平成25年11月現在)

	氏名	所属、役職
分科 会長	半那純一	東京工業大学 像情報工学研究所 教授
分科 会長 代理	大森裕	大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻教授
	がじ ひろのり 梶 弘典	京都大学 化学研究所 教授
	きとう かみあき 佐藤 文昭	株式会社産業創成アドバイザリー 代表取締役
委員	からうできました。	大阪府立大学 大学院工学研究科 電子·数物系専攻 教授
	OUEMAD まさや 枡川 正也	合同会社 FPD アソシエーツ 代表
	^{み うら のぼる} 三浦 登	明治大学 理工学部 電気電子生命学科 准教授

敬称略、五十音順

プロジェクト概要

	^		作成日	ı	平成 25	年10月9	日
プログラム(又は施策)名	次世代大型有機 EL ディスプレー	(基盤技術の	D開発(グ	リーンIT	プロジェク	ナト)	
プロジェクト名	次世代大型有機 LL ディスプレー	(基盤技術の	D開発	7゜ロシ	゛ェクト番号	P0801	1
担当推進部/担当者	電子・材料・ナノテクノロジー部 電子・材料・ナノテクノロジー部 電子・材料・ナノテクノロジー部 電子・材料・ナノテクノロジー部	担当者 田中担当者 田中	中 宏典、田 中 宏典、三	沼 清治(平橋 克典(平	成 22 年 7 月 成 22 年 4 月	~平成 24: ~平成 22:	年12月) 年6月)
〇. 事業の概要	地球温暖化対策として、社会ディスプレイの低消費電力化も力、高効率発光、広い視野角特ィスプレイ技術として期待され E L ディスプレイを製造するプディスプレイの基盤技術の開発より地球温暖化対策へ貢献する具体的には、大型有機 E L デ術・透明封止技術・有機製膜技術 2010 年代後半に、フルHD40 型量産化することを目指す。	重性 でロセスい でロセスい でロセスい でロンスい でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが でロンスが のいのでは、 でいる。 でい。 でいる。	と答いがっ のりになって、超がって、のはなって、 高組みになった 産製	いる。有機 類軽軽時はいいでの大幅ないである。 は変われている。 はなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	ELディスト においてでした。 おそれで、 はないこれで、 はない。 はていまする はい関わる。	プレイは に実現 は 型以上 (低消費電 (低消費電 るの大力 できません できない しょう はんしょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう
I. 事業の位置付け ・必要性について	テレビをはじめとする言精細の の確立が必須である。NEDO を平成 20 年度から開始している で、ディスプレイの消費である。 有機ELながの消費がは実現がでは、 有機を出ているでする。 有機を出ているですが、 有機を出ているですが、 では大型化の製造ないでは、 を学しているですが、 では大変では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	高でなる減消るは盤わ競ってエロが、プロではない開変に開変に関連を開接が開大のでは、プロでは、では、アロが、では、アロが、では、アロが、では、アロが、では、アロが、アロが、アロが、アロが、アロが、アロが、アロが、アロが、アロが、アロが	り機 な が の ト 解 来 力 な 力 な れ い が が 不 が が れ が れ が れ が れ が れ が れ が が れ が	置った。 され、をを おけれが行示術、あの国 でとして を を は た た た た た た た た た た た た た た た た た	少しン いてデ を模かして 視期ィ 堅でです 特れし 繰進め	代FPDプト (センジ 性、いのの 高る実 経がま にとがま	のロの なしこ 発常に対していません さいこう いっこう ないない いっぱい に重なが製 与で
Ⅱ.研究開発マネジメントに							
事業の目標	下記の研究開発項目に取り組む研究開発項目① 低損傷大面積率が低く、かつ、シート抵抗値術・製造プロセス技術を開発す研究開発項目② 大面積透明数率が低く、かつ、有機膜の発光の材料・構造、製造プロセス技研究開発項目③ 大面積有機製して、大面積であっても高度な均質性が得られ研究開発項目④ 大型ディスプ別要素技術の統合を通じて、スプ費電力が40W以下となること、以上の基板に対して適用可能です。	電極のる止特術膜なるレルお、 横のののは、 横の開かりです。 大きない 大きない 大きない かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かい	を発安る発ン造向以発している。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	情にわたででは、 は膜やたい発生を大きた。 が発生を発生を上げば、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	て 切 損 傷 い 有に に は は に は に に は に に は に に は に に に に に に に に に に に に に	成するた。 えずに、 ア性を有 E L 素内お 項目①、(対して想) (1500mm	かの材料技 可視光損膜 可する射料に対 用材が画素のの間 2)、3のの消 ×1850mm)
	主な実施事項	H20fy	H21fy	H22fy	H23fy	H24fy	
事業の計画内容	①低損傷大面積電子が対抗の開発 ②大面積型用は上技術の開発 ③大面積有機製製技術の開発 ④大型5、42、14製造に向けた機能					1 1 1	
50.00	会計・勘定	H20fy	H21fy	H22fy	H23fy	H24fy	総額
開発予算 (会計・勘定別に事業費 の実績額を記載) (単位:百万円)	一般会計 特別会計 (電多・高度化・石油の別)	743	858	648	674	361	3284
(平位:日八口)	Section (Miles for the Miles CVIII)						

	総予算額	743	858	648	674	361	3284	
	経産省担当原課	経済産業政	女策局 情	報通信機器	器課			
	プロジェクトリーダ	_ プロジェク プロジェク		(一) (一代行)	5部 哲夫 技木 伸樹			
開発体制	委託先	委託先(11機関):ソニー株式会社、株式会社東芝(*1)、 ヤーブ株式会社、住友化学株式会社、出光興産株式会社、 立行政法人産業技術総合研究所、長州産業株式会社、JSR 材 会社、株式会社島津製作所、大日本スクリーン製造株式会 日立造船株式会社 共同実施先(4大学):北陸先端科学技術大学院大学、金工業大学、九州大学、富山大学						
情勢変化への対応	ディスプレイ業界は	、国際的な技術開発競				状況にあ	るため、我	
有労変化への対心		大型ディスプレイの技術			とが重要で	ある。		
Ⅲ. 研究開発成果 (二ついて	有極りこのが付波)満り究塗い刷術均でめり産つ方発究上視技素型稿機膜、と開リ料プ素足、開布、装を買は、替性の法し開記光術技が論と、アイトの室で目面題改し得型以式のホータ(20年よのスをの名、「東京のス低目とびマの室で目面題改し得型以式のホークを発性、日本の大きのでででで、大きの大学のでで、「東京では、大きの大学で、大学で、大学で、大学で、大学で、大学で、大学で、大学で、大学で、大学で、	操応標大力面光化をし素シ面製でし積塗対型、周でサー型デ型ル度いた、開応標大力面光化をし素シ面製でし積塗対型、周でサー型デ型ル度いた等でである。 イステース という を積極したの上の はいかい という でんけん という でんけん です はいっと でいる という でんけん でき でんしょう という という でんけん でき でんしょう という という という という という という という という という とい	で司用ィ発大傷秀(ブな発有印大パブペート分ン・ 向要電レスにで司用ィ発大傷秀(ブな発有印大パブペート分ン・ 向要電レスにかいもス」面積少率クセ面 印パ積一セのを多に材化 た技を消一応つ、能レー基な90くス積 刷ラ化ニス有示の方料を 検術シ費ラフス 東北	子句でイー版〈%2を秀ー去メーン支機する代わ坊 証のミミごら子句でイー版〈%2を秀ー去メーン支機する代わ坊 証のまごごろの性る造 のか2)分開时 に夕座性を確成発素差つ 楽一35ィをダ高と可 産、い)た技 有最に有立膜源着発モつ 子シwを検	くを能 性高水大。術 機適関ししすに背源二蒸 効ヨに有証量確と に速蒸面両の 膜化わ、たるよきとタ着 率ンなすし産認な 優な気積技開 バ、る画。せるき組にレ にするるた性しつ れプ透均術発 タプ積素蒸ル大分み適一 対るここともたた るつ過一をに 一口み内着生面辿合しト す技とと	考。。 新セ率性組成 ンセ重お系産積度わたを る術を慮本 規ス(1) 膜合し 術条てび機式膜方る規面 ロ開した・ の件き画成を技式こ蒸加 セ発た	成技 明寺-5分せ。 生のた素膜可称開と着熱 スした膜術 有で 10年る 能最デ間技能、発にレ方 損、また 13年 対る2/3と 価化タわのすルしりトを 度該当にい 止表d)%)に を・・た開るブた、計考 と要該	
IV. 実用化、事業化 の見通しについて	1	後、各企業での実用化を 大幅な消費電力削減を				平成 27 年	~32 年頃)	
	事前評価			電子・情報		1		
Ⅴ. 評価に関する事項	中間評価以降	平成 22 年度 中間評価	面実施					
	作成時期	平成20年3月 作成						
VI. 基本計画に関する事項	変更履歴	平成 20 年 7 月 変更 平成 23 年 7 月 変更				本計画の制	定による)	

(*1)平成23年4月5日に東芝モパイルディスプレイ株式会社より事業継承

技術分野全体での位置づけ

(分科会資料6-1より抜粋)

(1)事業の位置付け・必要性

政策上の位置付け

公開

1-(1) NEDOの事業としての妥当性

経済産業省 研究開発プログラム(PG)

「ITイノベーションPG」及び「エネルギーイノベーションPG」の1テーマとして実施

第3期科学技術 基本計画(H18) 産業技術 新産業創造戦略 2005(H17) 政策

- ■情報通信分野は、研究開発の重点推進4分野(ライフサイエンス、 情報通信、環境、ナノテク・材料)の1つに位置づけられている。
- ■情報家電分野は、重点的に育成する戦略7分野の1つに位置づけ られている。

経済産業省研究開発プログラム

ITイノベーションプログラム

目的:高度情報通信ネットワーク社会の構築に向け、経済成長戦略大綱、IT新改革戦略、科学技術基本計画及び技術戦略マップ等に基づき、 情報化の進展に伴うエネルギー消費量の増大等の課題にも考慮しつつ、その基盤となる情報通信機器・デバイス等の情報通信技術を開発し、 情報化の進展に伴うエネルギー実社会への利用を促進する。

II. 省エネ革新 [i]情報ネットワークシステムの徹底的省エネの実現

次世代大型有機ELディスプレイ基盤技術の開発(グリーンITプロジェクト)

エネルギーイノベーションプログラム

- 目的: 資源に乏しい我が国が、将来にわたり持続的発展を達成するためには、革新的なエネルギー技術の開発、導入・普及によって、 各国に先んじて次世代型のエネルギー利用社会の構築に取り組んでいくことが不可欠である。
 - 各国に先んじて次世代型のエネルキー利用在本の情報になった。

 (中略)以下に5つの政策の柱毎に目的を示す。

 1. 総合エネルギー効率の向上

 II. 運輸部門の燃料多様化

 III. 新エネルギー等の開発・導入促進

 「「ロス・カニー・ロス・カー」

 「ロス・カニー・ロス・カー・ロ

I. 総合エネルギー効率の向上 [iv]省エネ型情報生活空間創生技術

└── 次世代大型有機ELディスプレイ基盤技術の開発(グリーンITプロジェクト)

事業原簿 公開p. I-1 次世代大型有機ELディスプレイ基盤技術の開発(グリーンITプロジェクト) 事後評価第1回分科会

(1)事業の位置付け・必要性

1-(1) NEDOの事業としての妥当性

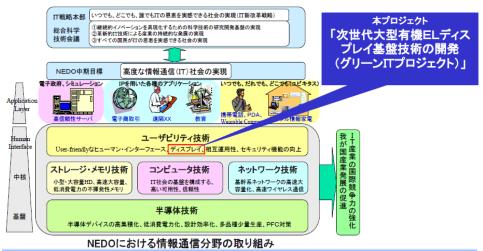
NEDO中期目標としての位置付け

公開

8/22

NEDO 第2期中期目標(2008~2012年) <情報通信分野>

- ■誰もが自由な情報の発信・共有を通じて、個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となる 高度な情報通信(IT)社会を実現
- ■我が国経済の牽引役としての産業発展を促進

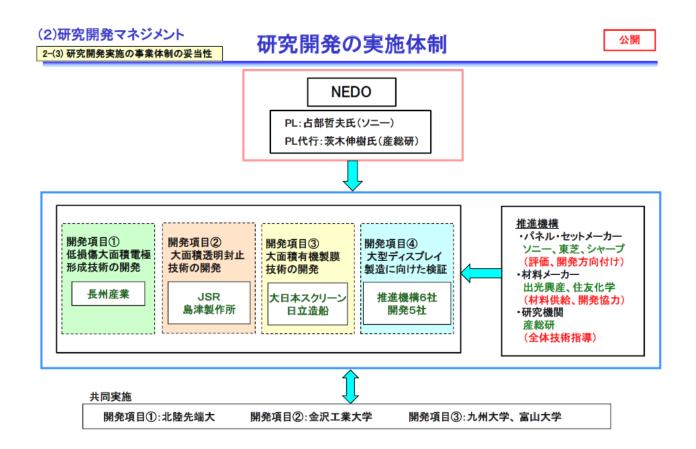


次世代大型有機ELディスプレイ基盤技術の開発(グリーンITプロジェクト) 事後評価第1回分科会

「次世代大型有機 EL ディスプレイ基盤技術の開発

(グリーン IT プロジェクト)」

全体の研究開発実施体制



事業原簿 公開p. II - 14 次世代大型有機ELディスプレイ基盤技術の開発(グリーンITプロジェクト) 事後評価第1回分科会

17/22

「次世代大型有機 EL ディスプレイ基盤技術の開発

(グリーン IT プロジェクト)」(事後評価)

評価概要 (案)

1. 総論

1)総合評価

本プロジェクトは、熾烈な国際競争の中で、わが国のディスプレイ産業の次世代の展開に不可欠な、有機 EL ディスプレイの先進的な製造技術の開発を目的として実施され、時宜を得たものである。開発の対象に、次世代の 4K テレビをにらんだトップエミッション方式を選択したのは、将来のディスプレイ技術の進展を考慮すると賢明であった。開発項目のほとんどは目標通り達成されており、開発の実施企業とユーザー企業を組み込んだ推進体制、必要な基盤技術の絞り込み、達成目標の数値化等、仕組みとマネジメントが功を奏したといえる。本プロジェクトにより、大型有機 EL ディスプレイ量産に向けての主要な基盤技術が確立された。また、材料や装置についての基盤技術に関する成果はプリンテッドエレクトロニクス等の他の分野への横展開も十分期待できる。

一方、本プロジェクトの開発目標達成のみによって、直ちに大型有機 EL ディスプレイが現状の大型ディスプレイ市場に必ずしも容易に参入できるものではない。特に、成果を本来使用すべき日本のパネルメーカーの体力が 2008 年のプロジェクト当初に比べて大きく低下している。引き続き、出口戦略構想の検討とその構想に基づいた追加推進策が必要である。

2) 今後に対する提言

開発された技術について、今後、パネルメーカーとともに生産に伴う諸問題を早期に解決を図り、有機 EL ディスプレイの製造技術として完成させ、わが国のディスプレイ産業の再興の基盤としていただきたい。今回のプロジェクトでは、目標達成に必要な要素技術から競争技術は除外されているが、材料、光取り出し、バックプレーン等の技術の確立なしには、大型有機 EL ディスプレイの事業化はない。今回確立された共通基盤技術に加え、競争技術を確立し、事業化まで展開して頂きたい。

実施者の企業が継続して機器開発と販売の努力を行っていることは評価できるが、海外に販売した機器による技術の流失が行われないように注意する必要がある。特許出願だけでは不十分であり、それぞれの企業において、総合的な

ビジネス戦略の策定が必要である。

2. 各論

1) 事業の位置付け・必要性について

有機 EL ディスプレイの普及によるディスプレイの省電力化の実現とその製造に不可欠な要素技術の開拓に主眼を置き、わが国の省エネルギー政策の一環として、また、ディスプレイ製造の先進技術の開発を通じてわが国のディスプレイ産業の巻き返しを支援するよう計画されたもので、位置付け・必要性は明確である。特に、本事業のターゲットをトップエミッション型有機 EL ディスプレイとしたことは、リスクを伴うものの、将来のディスプレイ技術の進展を考慮すると、時宜を含めて賢明であったと判断される。対象とする基盤技術は、材料メーカー、製造装置メーカー、パネル・セットメーカーなどが共同して開発に当たらなければ実現できない課題であり、NEDO の関与は適切なものであったと判断される。

ディスプレイの製造にはTFT技術は不可欠であり、今後、ディスプレイとしての総合的な視点に立った事業計画や他の事業との連携を視野に入れた取り組みも必要である。

2) 研究開発マネジメントについて

開発計画並びに技術課題は、共通基盤技術としていずれも競争力醸成に不可欠な項目に絞られており、且つ課題毎にターゲットが明確に数値化されている。数値目標を達成するには厳しいスケジュールであったが、ほぼ全てが達成されており、妥当なスケジュールと予算であった。また、セットメーカーや材料メーカーを含む複数の企業をプロジェクトに加え、開発技術や状況に関する情報共有や意見聴取の仕組みを取り入れたことは、実用化に向けてのシナリオ作りやユーザーの確保、技術の普及の点で有効であった。さらに、本プロジェクトの要とも言える課題に対し、開発加速のための資金の投入が図られたことも積極的に評価できる。プロジェクトリーダーは、要素技術を開発する企業を束ねる意味で、パネル・セットメーカーから選出されていることも妥当である。

一方、本プロジェクトでは、実デバイスの試作を通じた成果の検証は開発項目として挙げられていないが、G6 基板サイズでないまでも、開発成果の有効性が実証できるサイズのディスプレイの試作により、成果を実証することも、実用化へ向けての技術保障を得るという観点から、必要であったのではないか。また、バックプレーン技術も開発項目から外されたが、大型有機 EL ディスプレイの実用化を目指すには、将来的には、バックプレーン技術も開発するのが妥当である。さらに、知的財産の運用に関しては、参加企業の戦略に任せるとし

ているが、成果の普及に先立って、国際競争力の確保・維持の観点から何らかの基本的な指針を策定しておく必要があろう。

3) 研究開発成果について

ほぼ全ての数値目標が達成された。40 インチ大型有機 EL ディスプレイの製造にかかわる基盤技術を構築するという本事業の目的に対し、開発された成果の意義は大きい。塗布型大面積有機製膜技術の一部の課題は技術目標に到達できなかったものの、技術の限界と解決のための技術課題が明確となったことは、将来、発展が期待されるプリンテッドエレクトロニクスへの展開の基盤としても活かされるであろう。成果の普及に関しては、大学の成果を中心に適正な規模で、一般向けに成果が公表されており、実用化の担い手・ユーザー等に対しても適切に情報発信が行われている。

一方、省電力化の評価は、実際の結果を反映できる、ある程度集積化された デバイスにおける評価を基にすべきであったのではないか。同様に、個々の技 術も大面積化を評価できるサイズの素子を試作して評価することが必要であっ たのではないか。さらに、シミュレーション結果の妥当性を、何らかの形で検 証しておく必要があろう。大学で実施された研究開発は、全てではないが、必 ずしも企業で技術開発を支援するという観点ではうまく機能しているとは言え ない。本プロジェクトにおいて、どのような役割を大学に期待するかを含めて、 事業内での位置づけや具体的な実施課題の選定などについて、調整が必要であ った。

4) 実用化に向けての見通し及び取り組みについて

開発された低損傷大面積電極形成技術、大面積透明封止技術、大面積有機製膜技術は、要素技術としても高いレベルにあり、大型有機 EL ディスプレイの実用化に大きく貢献することが期待される。各要素技術に関して、単独で実用化が図れるものについては実用化が進行している点も高く評価できる。トップエミッション型ディスプレイの先進性も今後の市場展開にとって有利であろう。各要素技術開発においてタクトタイム 2 分以内を実現しており、本プロジェクトの技術を集積した量産ラインにおける整合性も保たれている。開発された製造装置は、他の用途向けを含めて事業化できるものが多く含まれている。

一方、日本のパネルメーカーで実用化の構図が描きにくいことが残念である。 また、製造装置の開発が主体となっているため、装置を輸出した際に海外への 技術の流出が懸念される。特許出願だけでは不十分であり、先々まで見据えた 総合的なビジネス戦略の策定が必要である。

個別テーマに関する評価

	No territoria del Constitución de la constitución d		A (6) 11) 12 19 19
	成果に関する評価	実用化・事業化に向けての見通し	今後に対する提言
		及び取り組みに関する評価	
低損傷大面積電	ミラートロンスパッタ法によ	ディスプレイの電極形成装置	大型有機 EL ディスプレイが実
極形成技術の開	って透明カソード電極を有機薄	として実用化の目途ができた。市	用化を迎える時期には、より高い
発	膜上に低損傷度で形成する技術	場・ユーザーのニーズに合致して	性能が求められるので、他の材料
	と装置の開発は、革新的であり高	おり、今後、十分な展開が期待さ	 についても検討を進めることが
	く評価できる。装置構成からみて	れる。装置ビジネスとして、実用	有効であろう。また、有機 EL 用
	、G6基板サイズ以上の大型基板へ の適用も可能であろう。有機薄膜	化・事業化への取り組みが明確に 示されている。また、プラズマダ	途に限らず、汎用性のある低損失
	上への低ダメージの透明電極の	水ごれている。よた、ノノハドク メージを嫌う他の材料の製膜に	透明電極形成装置として開発が
	形成は、有機ELに限らず有機デバ	も基本的に活用でき、他分野への	行われることを期待する。酸化物
	イスの製造において重要な技術	展開や普及も期待できる。	半導体等に関する製膜技術とし
	である。さらに大面積の電極形成	実用化に当たっては、実際にG6	ても、原理的に展開が可能であ
	が可能な装置の開発が行われた	サイズに適用可能な装置を設計	
	ことは電極形成技術として汎用	し、実機を用いた実証が待たれる	る。また、フレキシブル基板をベ
	性がありその影響力は大きい。大	。また、装置のコンセプトがシン	ースとした成膜プロセスやロー
	学が劣化機構を解明しており、ミ	プルであるだけに、技術の模倣が	ルツーロール等の新たな生産技
	ラートロンスパッタによる損傷	比較的容易であることが懸念さ	術への波及が期待できる。さら
	以外の劣化要因を把握できてい	れる。実用化に際してはしっかり	に、ここで培った技術を小型化に
	る。この知見は、将来の有機EL 素子の劣化解析に有用である。	したビジネス戦略が必要不可欠	よって、簡易な製膜技術として展
	※丁の労化解析に有用である。 一方、研究開発費の追加を含め		開できれば面白い。
	、研究開発費が有効に成果につな		なお、海外への技術流出が懸念
	がっているが、本技術はプロジェ		される。日本の半導体・液晶装置

۲	_	1
)

クトの鍵の一つであり、予め経費 の見積もりが十分ではなかった 点は反省点である。将来の高効率 化のために、スパッタ装置の特性 を活用した他の材料構成につい ても、合わせて検討を行う必要が あろう。 業界全体でどのような対策があるのか、議論することも必要である。

大面積透明封止 技術の開発

新しい発想と材料系の開発により、要求性能を満たす材料が実現できた。有機膜への損傷度が少なく且つ長寿命の透明デシカント材が開発された意義は大きく、また、表面波プラズマ CVD 法によって低ダメージの SiNx 膜が形成できたことは高く評価できる。両者の組み合わせで、15年以上の封止性能を達成したことは特筆に値する。さらに、大面積適用性も実用性の高い方法によって簡便に実現した点も評価できる。

一方、ピンホールの存在が懸念 される。また、SiNx 以外の材料 との組み合わせについても検討

実用化は生産設備さえ整えば、 早い時期に可能である。デシカン ト材料は実用性が高く、実用化に 向けて具体的な検討が行われて いる。SiNx 薄膜を製膜する表面 波プラズマ CVD 装置は、現有し ている高密度プラズマ技術を応 用展開したもので、製品化への障 壁は低い。テレビ用に採用される ことになれば、潜在的な市場は 2020年に1000億円になるという | 見方もあり、事業化のメリットは | 大きい。また、他の電子素子や将 来展開が期待されるプリンテッ ドエレクトロニクスのデシカン ト技術としても展開が可能であ

無機ガスバリア薄膜、固体デシカント剤の製膜過程を最適化し、大面積化への対応を引き続されたでいる。開発された大型テレビ向けの実際がある。開発された大型テレビ向けの実際がは、大型テレビ向けの実際が見といる。SiNx以外のバリアをといる。SiNx以外のバリアを関として有効な材料の探索、保存安にの検討が材料の改善に役立つ。が対した対した、流用性を持つもいりも、汎用性を持つもが開発できれば用途も大きくがる。

	1
	7
_	4

すれば、技術の幅が広がった。

なお、トップエミッション構造 を採用する海外企業の中小型有 機 EL ディスプレイは別方式によ る封止であるが、優位性を明確に する必要があろう。

ろう。

一方、材料、製造方法 を知的財産権で保護され ているが、類似品が出回 らないように注視する必 要がある。

大面積有機製膜 技術の開発

蒸着法による有機製膜におい て、高速で大面積の製膜が可能と なり、さらに、独自の機能として セル生産方式にも対応している。 有機 EL ディスプレイの核となる 技術であり、極めて重要な成果で ある。印刷法による有機製膜で は、一部の課題で最終目標未達で あるが、詳細な検討によって問題 のありかを探し出し、適宜、改善 ドエレクトロニクスの技術開発 にも活かされていくと期待でき る。

有機製膜は有機 EL パネルの重 要な工程であり、システム価格は 100 億円前後と高価になるため、 市場規模も大きく、事業化による 経済メリットはある。蒸着法有機 製膜装置は、大面積化、高精細化、 蒸発源の多源などを行うことで さらに高性能化をめざし、国際的 に他の追従を許さない製膜装置 を完成できる可能性がある。印刷 指針を見出した取り組みは、評価 法による有機製膜の技術は、実用 される。この成果は、プリンテット化に少し時間は必要だが、完成す ると国際競争力のある技術にな

一方、蒸着法有機製膜装置につ「ロセス低コスト化には、大面積有

独自性があり、有機薄膜の生産 技術として、優位性と実用性の高 い技術と判断されるので、パネル メーカーと組んで大型基板を用 いたデバイスの作りこみによる 装置の実用的な実証と改良を進 め、早急に実用化を目指してほし い。蒸着法による有機成膜技術 は、蒸着できる温度範囲をさらに 広げる努力も必要である。印刷法 による有機成膜技術(有版印刷) は、多種のインクに適用できる版 が準備できるよう開発を行う必 要がある。有機デバイスの製膜プ は、大型基板を用いたデバイスレー伴い価格が急速に下落するので、 ベルでの検証が待たれる。RGB 材料の利用効率をさらに高め、装 材料パターンを形成する際の装 | 置価格も下げることが必要であ | 置上の干渉、パーティクル、材料 | ろう。印刷法による有機製膜技術 | 汚染等の問題、マスク操作など、 実用化にはさらに検討が必要なしの求める高精細化のスピードに 課題も多い。有機発光材料によっしついていけるかが課題であろう。 ては本手法になじまないものも あると考えられるので、材料メー カーと協調し、材料との適合性を 広く検討することも必要である。 印刷法を用いた有機製膜は、版材 | 展のために、この問題にうまく取 の検討による特性の改善を見極 める必要があろう。

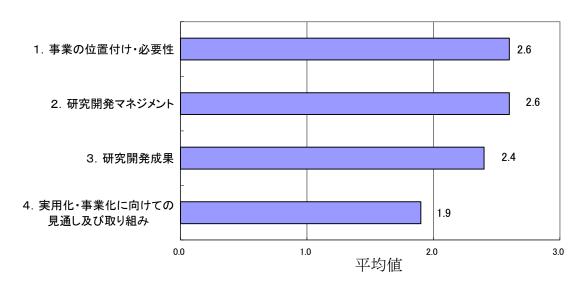
蒸着法有機製膜装置について いて、有機発光材料は生産数量に | は、高精細化が難点であり、市場

> なお、開発された技術の普及と | 技術の拡散は避けがたい難問で あるが、有望な技術だけに、是非、 わが国のディスプレイ産業の発 り組んで欲しい。

版印刷のような塗布技術の確立 が不可欠であり、長期的な視野に 立ち、継続的な開発と支援が必要 である。また、有版印刷の適用先 として、テレビだけでなく、実用 化の早そうな業務用分野などを 開拓するのもよい。

	成果に関する評価	今後に対する提言
大型ディスプレイ	人と時間、お金のかかる試作を通じた検証に代	消費電力を見極めていくうえでシミュレーショ
製造に向けた検証	わり、シミュレーションを利用した研究成果の実	ン技術を磨き上げていくことは、費用対効果の観
	証は、取り組みとして一つの方法であろう。大型	点から必要である。シミュレーション技術の確度
	ディスプレイ製造に向けた 3 つの開発課題(低消	について、現状の液晶ディスプレイでは、このシ
	費電力化、大型基板適応性、生産性)に関する検	ミュレーション技術は有効であったのかどうか検
	証はいずれも妥当性があり、技術競争力のある共	証してはどうか。
	通基盤技術が確立されたと評価できる。	また、シミュレーションの有効性を実際のディ
	しかしながら、シミュレーションで得られた内	スプレイにおいて検証することが望まれる。
	容が、実際の試作による実証結果と同等であるか	
	については、何らかの方法で検証が必要である。	
	実際、40インチの集積化された素子からなるディ	
	スプレイと基板上に形成された数個の素子とは隔	
	たりは大きいように思える。また、有機 EL ディ	
	スプレイの生産で重要なポイントは製造歩留まり	
	であるが、実証できていない。	

評点結果 [プロジェクト全体]



評価項目	平均值			素点	点 (注	主)		
1. 事業の位置付け・必要性について	2.6	A	A	В	A	В	В	A
2. 研究開発マネジメントについて	2.6	A	A	С	A	A	В	A
3. 研究開発成果について	2.4	В	A	A	В	В	В	A
4. 実用化・事業化に向けての見通し	1.0	ъ	D	C	ъ	C	ъ	٨
及び取り組みについて	1.9	В	D		D		D	А

(注) A=3, B=2, C=1, D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。

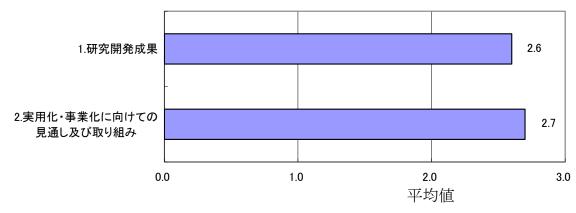
〈判定基準〉

- 1. 事業の位置付け・必要性について 3. 研究開発成果について ・非常に重要 →A ・非常によい $\rightarrow A$ →B · よい • 重要 $\rightarrow B$ ・概ね妥当 →C ・概ね妥当 \rightarrow C ・妥当性がない、又は失われた →D ・妥当とはいえない $\rightarrow D$
- 2. 研究開発マネジメントについて 4. 実用化・事業化に向けての見通し 及び取り組みについて

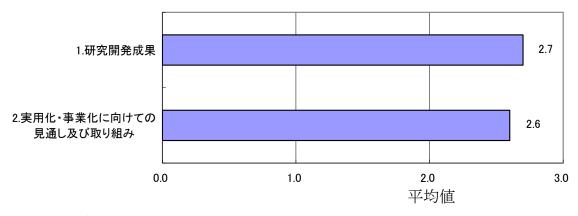
非常によい	\rightarrow A	• 明確	\rightarrow A
・よい	\rightarrow B	• 妥当	\rightarrow B
・概ね適切	\rightarrow C	・概ね妥当	\rightarrow C
適切とはいえない	\rightarrow D	・見涌しが不明	\rightarrow D

評点結果〔個別テーマ〕

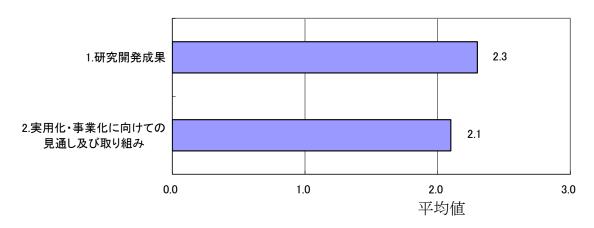
低損傷大面積電極形成技術の開発



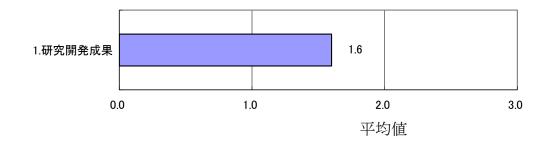
大面積透明封止技術の開発



大面積有機製膜技術の開発



大型ディスプレイ製造に向けた検証



個別テーマ名と評価項目	平均値 素点(注)							
低損傷大面積電極形成技術の開発								
1. 研究開発成果について	2.6	В	В	A	A	A	В	A
2. 実用化・事業化に向けての見通し	9.7	В	A	A	A	A	В	Α
及び取り組みについて	2.7	Ъ	A	A	A	A	Ъ	A
大面積透明封止技術の開発								
1. 研究開発成果について	2.7	В	A	A	A	A	В	A
2. 実用化・事業化に向けての見通し	0.0	В	A	A	В	A	В	A
及び取り組みについて	2.6	Б	A	A	Б	A	Ъ	A
大面積有機製膜技術の開発								
1. 研究開発成果について	2.3	В	A	A	В	В	В	В
2. 実用化・事業化に向けての見通し	0.1	В	A	٨	С	В	В	В
及び取り組みについて	2.1	D	A	A		Б	Ъ	Б
大型ディスプレイ製造に向けた検証								
1. 研究開発成果について	1.6	В	С	С	В	В	C	В

(注) A=3, B=2, C=1, D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。

〈判定基準〉

1. 研究開発成果について		2. 実用化・事業化に向けての	の見通し
		及び取り組みについて	
・非常によい	\rightarrow A	・明確	\rightarrow A
· よい	\rightarrow B	・妥当	\rightarrow B
・概ね適切	\rightarrow C	・概ね妥当	\rightarrow C
適切とはいえない	\rightarrow D	・見通しが不明	\rightarrow D

「次世代大型有機 EL ディスプレイ基盤技術の開発

(グリーン IT プロジェクト)」に係る

評価項目·評価基準

1. 事業の位置付け・必要性について

(1) NEDOの事業としての妥当性

- ITイノベーションプログラム、エネルギーイノベーションプログラムの目標達成のために寄与しているか。
- ・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことにより、NEDOの関与が必要とされる事業か。
- ・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較 において十分であるか。

(2) 事業目的の妥当性

・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、 政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。

2. 研究開発マネジメントについて

(1) 研究開発目標の妥当性

- 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されているか。
- ・ 目標達成度を測定・判断できる具体的かつ明確な開発目標を設定している か。

(2) 研究開発計画の妥当性

- 目標達成のために妥当なスケジュール、予算(各個別研究テーマごとの配 分を含む)となっているか。
- 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。
- ・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。
- ・ 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点 から絞り込んだうえで活用が図られているか。

(3) 研究開発実施の事業体制の妥当性

- 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。
- ・ 適切な研究開発実施体制になっており、指揮命令系統及び責任体制が明確 になっているか。
- ・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携及び競争が十分に 行われる体制となっているか。
- ・ 知的財産取扱(実施者間の情報管理、秘密保持、出願・活用ルール含む) に関する考え方は整備され、適切に運用されているか。

(4) 研究開発成果の実用化・事業化に向けたマネジメントの妥当性

- ・ 成果の実用化・事業化につなげる戦略が明確になっているか。
- ・ 成果の実用化・事業化シナリオに基づき、成果の活用・実用化の担い手、 ユーザーが関与する体制を構築しているか。
- ・ 全体を統括するプロジェクトリーダーが選任されている場合、成果の実用 化・事業化シナリオに基づき、適切な研究開発のマネジメントが行われて いるか。
- ・ 成果の実用化・事業化につなげる知財戦略(オープン/クローズ戦略等) や標準化戦略が明確になっており、かつ妥当なものか。

(5) 情勢変化への対応等

・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向等に 機敏かつ適切に対応しているか。

3. 研究開発成果について

(1) 目標の達成度と成果の意義

- ・ 成果は目標を達成しているか。
- ・ 成果は将来的に市場の拡大あるいは市場の創造につながることが期待できるか。
- ・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。
- ・ 目標未達成の場合、達成できなかった原因が明らかで、かつ目標達成まで の課題を把握し、この課題解決の方針が明確になっているなど、成果とし て評価できるか。
- 設定された目標以外に技術的成果があれば付加的に評価する。
- ・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、又は汎用性のある成果については、将来の産業につながる観点から特に顕著な成果が上がっている場合は、海外ベンチマークと比較の上で付加的に評価する。

- 投入された予算に見合った成果が得られているか。
- ・ 大学又は公的研究機関で企業の開発を支援する取り組みを行った場合には、 具体的に企業の取り組みに貢献しているか。

(2) 知的財産権等の取得及び標準化の取組

- ・ 知的財産権等の取扱(特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登録、品種登録出願、営業機密の管理等)は事業戦略、又は実用化計画に沿って国内外に適切に行われているか。
- ・ 国際標準化に関する事項が計画されている場合、得られた研究開発の成果 に基づく国際標準化に向けた提案等の取組が適切に行われているか。

(3) 成果の普及

- ・ 論文等の対外的な発表は、将来の産業につながる観点から戦略的に行われ ているか。
- ・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザー等に対して、適切に成果を普及しているか。また、普及の見通しは立っているか。
- 一般に向けて広く情報発信をしているか。

|4. 実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて

本項目における「実用化・事業化」の考え方

当該研究開発に係る試作品、サービス等の社会的利用(顧客への提供等)が開始されることであり、さらに、当該研究開発に係る商品、製品、サービス等の販売や利用により、企業活動(売り上げ等)に貢献することを言う。

(1)成果の実用化・事業化の見通し

- ・ 産業技術としての見極め(適用可能性の明確化)ができているか。
- 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっているか。
- 成果は市場やユーザーのニーズに合致しているか。
- ・ 実用化に向けて、競合技術と比較し性能面、コスト面を含み優位性は確保 される見通しはあるか。
- 量産化技術が確立される見通しはあるか。

- ・ 事業化した場合に対象となる市場規模や成長性等により経済効果等が見込めるものとなっているか。
- ・ 国際標準化に関する事項が計画されている場合、国際規格化等、標準整備 に向けた見通しが得られているか。
- ・ プロジェクトの直接の成果ではないが、特に顕著な波及効果(技術的・経済 的・社会的効果、人材育成等)がある場合には付加的に評価する。

(2)実用化・事業化に向けた具体的取り組み

・ プロジェクト終了後において実用化・事業化に向けて取り組む者が明確になっているか。また、取り組み計画、事業化までのマイルストーン、事業化する製品・サービス等の具体的な見通し等は立っているか。